

(XN)₄R₄ 簇合物的结构与化学键 *

武海顺 许小红 张聪杰 张富强

(山西师范大学化学系, 临汾 041004)

摘要 用密度泛函理论, 在 B3LYP/6-311G* 水平上, 对(XN)₄R₄ (X = C, Si, Ge; R = H, CH₃, NH₂, OH) 及合成的先驱化合物(XN)₂R₂ 进行几何构型、电子结构、振动频率和化学反应焓变等进行了研究。结果表明, (RCN)₄ 比(CNR)₄ 更稳定。所有簇合物的零点能 E_{ZP} 值, R = H 时最小, R = CH₃ 时最大, R 配位原子依次为 C, N 和 O 时, E_{ZP} 值逐渐减小。

关键词: (XN)₄R₄ 立方簇, 密度泛函理论方法, 结构, 化学键

中图分类号: O641

自 1964 年 Eaton^[1]发现 C₈H₈ 立方烷团簇以来, 因其结构的特殊性而表现出一些特殊的性质, 是高能炸药、火箭推进剂、药物和聚合物科学领域的一类性能优异的新型功能材料, 因而受到物理学家、化学家和材料学家的高度关注。Matsumoto^[2]合成了 Si₈H₈, Lukin^[3]报导了至今为止含能量高的簇合物 C₈(NO₂)₈, Del Piero^[4]合成了以 Al₄N₄ 为骨架的类立方烷系列簇合物(RAlNR)₄, Veith^[5]对(XNR)₄ (X = Si, Ge, Sn, Pb) 进行了研究, 合成了 Si₂Ti₂N₄R₄^[6], (GeNR)₄^[7], (SnNR)₄^[8], (PbNR)₄^[9], Sn₂Pb₂N₄R₄ 等许多类立方烷结构簇合物。Chen^[10]报导了(XN)₄ (SiMe₃)₄ 和(XN)₄(2, 6-i-Pr₂C₆H₃)₄ (X = Ge, Sn, Pb) 的结构与光谱学性质。Allan^[11]研究了(SnN)₄ (C₆H₁₁)₄ 和(SnN)₄(CH₂C₅H₄N)₄ 的结构。Grigsby^[12]报导了(GeN)₄Ph₄, (SnN)₄Ph₄ 和(PbN)₄Ph₄ 的核磁共振和红外光谱实验结果。Alexey^[13]研究了化学气相沉积(CVD)中产生的(ClAlNH)₄ 簇合物的结构和热力学性质。我们曾用飞行时间质谱和量子化学方法讨论了(AlN)₄^[14]、(HAlNH)₄^[15]和(HAlNH)₄^[16]簇的结构和稳定性。对于类立方烷团簇的实验合成与结构表征工作日益增多, 但对立方骨架为(XN)₄R₄ 簇合物的电子结构、稳定性和化学键性质的研究尚未见报导。因此, 本文用密度泛函理论(DFT), 对

(XN)₄R₄ (X = C, Si, Ge; R = H, CH₃, NH₂, OH) 进行了理论研究, 从理论上揭示了这类团簇的结构和稳定性。

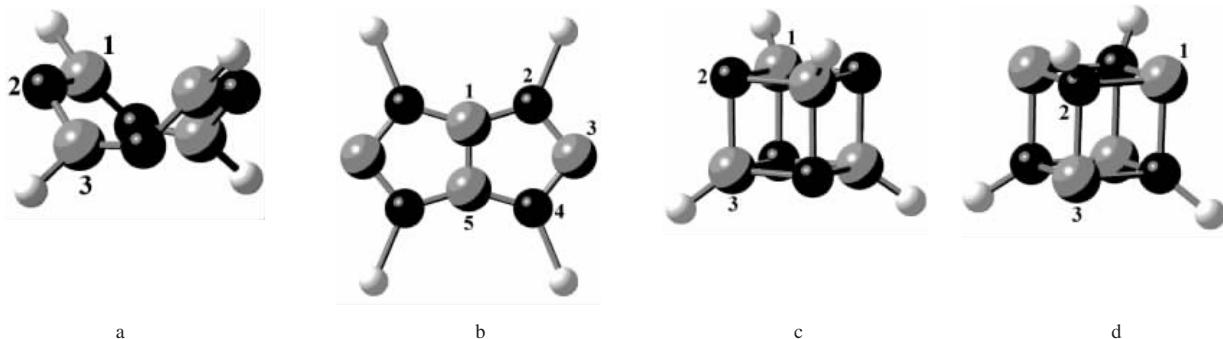
1 计算方法

首先选用不考虑电子相关的 HF 方法及 3-21G 6-31G* 基组, 对(XN)₄R₄ (X = C, Si, Ge; R = H, CH₃, NH₂, OH) 及合成的先驱化合物(XN)₂R₂ 进行优化计算, 再用考虑了电子相关作用的密度泛函理论(DFT)进行结构优化、红外光谱和热力学性质计算。交换函数选用 Becke 3, 相关函数为 LYP 函数, 所有分子的计算均采用 6-311G* 的三“Zeta”加极化基组。全部计算选用 Gaussian-98 程序, 在山西师范大学材料化学研究所 SGI/O2 工作站上完成。

2 结果与讨论

2.1 几何构型

由 B3LYD/6-311G* 方法优化而得到的(XN)₄R₄ 的 22 种簇合物的平衡态几何结构如图 1 所示, 相应的几何结构参数和分子点群列于表 1 中, 由表 1 和图 1a 可见, (RCN)₄ (R = C, CH₃, NH₂, OH) 簇的几何构型与 1, 3, 5, 7- 四甲基环辛四烯结构相同, 均为 S₄ 点群对称。C1-N2 与 C3-N2 键长随 R 配位元

图 1 $(XN)_4R_4$ 簇合物的几何构型Fig. 1 The geometries of $(XN)_4R_4$ clustersa) $(RCN)_4$, b) $(CNR)_4$, c) $(RXN)_4$ ($X = Si, Ge$), d) $(XNR)_4$ ($X = Si, Ge$)

素(C, N, O)电负性的增加而缩短, C1-N2 键长变化在 0.1303~0.1293 nm 之间, 显示出明显的双键特征, 而 C3-N2 键长在 0.1390~0.1366 nm 之间变化, 介于单双键之间。随 R 配位元素由 C 至 O, N-C-N 键角和 C-N-C 键角逐渐增大, N-C-R 键角逐渐减小。由表 1 和图 1b 可见, $(CNR)_4$ ($R = H, CH_3$) 簇合物的骨架结构均为双五元环平面结构, 分子点群分别为 D_{2h} 和 C_{2v} . $(CNR)_4$ 簇合物

中还形成了 C1-C5 键, 这是 22 种簇合物中仅有的一类。与 R 为 H 和 CH_3 相对应, C1-C5 键长分别为 0.1351 和 0.1352 nm; C-N-R 键角分别为 126.6° 和 126.9°, 而 C-N-C 键角分别为 112.0° 和 110.6°。由表 1 和图 1 中 c, d 可见, $(RSiN)_4$ 、 $(SiNR)_4$ 、 $(RGeN)_4$ 和 $(GeNR)_4$ 等 4 种簇合物的骨架结构均为立方体型, 分子点群随 R 的不同而不同, 当 R 为 H, CH_3 , NH_2 和 OH 时, 分别为 T_d , D_{2d} ,

表 1 $(XN)_4R_4$ 簇合物的结构参数和分子点群Table 1 The geometries and point group of $(XN)_4R_4$ clusters

Cluster	Piont group	X1-N2/nm	X3-N2/nm	X(N)-R/nm	N-X-N/(°)	X-N-X/(°)	N-X-R/(°)	X-N-R/(°)
$(HCN)_4$	S_4	0.1278	0.1390	0.1080	127.2	120.3	114.6	
$(H_3CCN)_4$	S_4	0.1303	0.1390	0.1500	125.0	120.2	114.8	
$(H_2NCN)_4$	S_4	0.1300	0.1370	0.1360	129.5	121.8	113.4	
$(HO CN)_4$	S_4	0.1293	0.1366	0.1338	131.5	122.2	113.1	
$(CNH)_4$	D_{2h}	0.1389	0.1378	0.1010	102.6	112.0		126.6
$(CNCH_3)_4$	C_{2v}	0.1389	0.1377	0.1452	104.3	110.6		126.9
$(HSiN)_4$	T_d	0.1804	0.1804	0.1470	93.6	86.3	122.7	
$(H_3CSiN)_4$	D_{2d}	0.1808	0.1808	0.1850	93.4	86.4	122.8	
$(H_2NSiN)_4$	D_{2d}	0.1800	0.1801	0.1688	94.8	85.1	120.6	
$(HOSiN)_4$	D_2	0.1788	0.1801	0.1620	94.1	85.9	119.6	
$(SiNH)_4$	T_d	0.1921	0.1921	0.1013	82.1	97.4		119.8
$(SiNCH)_4$	D_{2d}	0.1920	0.1920	0.1473	83.4	96.3		118.7
$(SiNNH_2)_4$	D_{2d}	0.1919	0.1931	0.1453	82.9	96.3		117.1
$(SiNOH)_4$	D_2	0.1915	0.1933	0.1438	80.7	99.7		113.3
$(HGeN)_4$	T_d	0.1939	0.1939	0.1536	92.7	87.3	123.4	
$(H_3CGeN)_4$	D_{2d}	0.1941	0.1941	0.1947	92.7	87.3	123.4	
$(H_2NGeN)_4$	D_{2d}	0.1940	0.1950	0.1818	94.1	85.9	120.5	
$(HOGeN)_4$	D_2	0.1925	0.1942	0.1760	93.7	86.3	120.1	
$(GeNH)_4$	T_d	0.2035	0.2035	0.1015	81.0	98.4		119.0
$(GeNCH_3)_4$	D_{2d}	0.2037	0.2037	0.1467	82.3	97.2		118.1
$(GeNNH_2)_4$	D_{2d}	0.2036	0.2050	0.1450	82.1	96.8		116.0
$(GeNOH)_4$	D_2	0.2033	0.2056	0.1439	79.7	99.2		111.7

表 2 (XN)₄R₄ 的谐振频率和红外光谱强度*Table 2 The vibration frequencies and IR of (XN)₄R₄ clusters

Cluster	X	ν/cm^{-1}			
		H	CH ₃	NH ₂	OH
(RXN) ₄	C	230.4(0)	92.4(0)	76.3(0)	77.5(0)
		1687.8(376)	1691.9(454)	1679.6(992)	1735.4(869)
	Si	408.9(0)	117.3(0)	34.9(0)	54.9(0)
		908.0(439)	907.8(318)	250.9(659)	852.6(773)
	Ge	236.0(0)	66.6(0)	42.7(0)	11.6(0)
		712.5(243)	639.8(215)	514.5(646)	724.7(321)
	C	94.1(0)	91.1(0)		
		701.7(291)	3037.9(235)		
(XNR) ₄	Si	305.2(0)	150.7(0)	39.9(0)	121.1(0)
		1054.1(380)	664.4(315)	686.1(441)	698.4(362)
	Ge	170.2(0)	140.8(0)	93.9(0)	127.5(0)
		969.2(205)	563.4(225)	586.9(334)	595.1(226)

*Instensity of IR in the brace

D_{2d} 和 D_2 , 键长和键角的变化规律也趋于一致, X1-N2 和 X-R 或 N-R 键长逐渐减小, 前者减小幅度比后者小得多, 而 X3-N2 键长逐渐增大。如 (GeNCH₃)₄、(GeNNH₂)₄ 和 (GeNOH)₄ 中的 Ge1-N2 键长分别为 0.2037、0.2036 和 0.2033 nm, 减小幅度仅为 0.0001 和 0.0003 nm; 而 N-R 键长分别为 0.1467、0.1450 和 0.1439 nm, 减小幅度分别为 0.0017 和 0.0011 nm; 而 Ge3-N2 键长分别为 0.2037、0.2050 和 0.2056 nm, 增大幅度分别为 0.0013 和 0.0006 nm。键角的变化也呈现明显的规律性, 这里不再赘述。

2.2 分子振动光谱

用 HF 和 B3LYP 两种方法对 (XN)₄R₄ 立方簇合物的 22 种结构及相应的分子碎片 (XN)₂R₂ 进行了谐振频率计算, 得到了最低能量结构的振动频率 ν 和 IR 强度 I 。限于篇幅, 我们只将由 B3LYP/6-311G* 方法得到的 (XN)₄R₄ 分子的最小振动频率和 IR 强度 I 最大值对应的振动频率列于表 2 中。 ν

值最小的振动频率就可以反映所得结构是否存在虚频, 振动强度 I 最大值对应的谐振频率可以反映最强吸收峰的位置。从表 2 可以看出, 22 个结构的最低谐振频率均为正值, 表明所对应的结构为平衡基态。R 为 H 和 CH₃ 对应的最小振动频率均大于 R 为 NH₂ 和 OH 的值, 表明实验上合成 (XN)₄H₄ 和 (XN)₄(CH₃)₄ 比 (XN)₄(NH₂)₄ 和 (XN)₄(OH)₄ 更容易。

2.3 簇合物的稳定性

2.3.1 总能量、零点能和能隙

表 3 是由 B3LYP/6-311G* 方法得到的 (XN)₄R₄ 簇合物的总能量、零点能和能隙。可以看出, 同分异构体 (RCN)₄ 比 (CNR)₄ 总能量 E_T 低, 表明前者稳定。(RSiN)₄ 和 (SiNR)₄ 比较, 除 (SiNH)₄ 的 E_T 比 (HSiN)₄ 低以外, 其余结构均为 (RSiN)₄ 更稳定。在 (RGeN)₄ 和 (GeNR)₄ 中, R 为 H 和 CH₃ 时, 后者 E_T 较低; R 为 NH₂ 和 OH 时, 前者 E_T 较低。所有簇合物的 E_{ZP} 值, R = H 时最小, R = CH₃ 时最大, R 配位

表 3 (XN)₄R₄ 簇合物的总能量、零点能和能隙Table 3 The total energy E_T , zero point energy E_{ZP} and energy gap ΔE of (XN)₄R₄ clusters

R	$E_T/\text{a.u.}$			$E_{ZP}/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			$\Delta E/\text{eV}$			
	C	Si	Ge	C	Si	Ge	C	Si	Ge	
(RXN) ₄	H	-373.86	-1379.63	-8529.45	227.6	157.8	129.1	4.87	6.38	5.36
	CH ₃	-531.19	-1537.01	-8686.80	516.8	457.5	435.9	4.98	6.64	5.31
	NH ₂	-595.42	-1601.30	-8751.02	408.8	341.8	321.6	5.28	5.71	4.79
	OH	-624.89	-1680.83	-8830.53	281.5	221.8	190.1	4.68	5.36	4.38
(XNR) ₄	H	-373.80	-1379.67	-8529.67	234.4	187.2	171.4	6.18	4.46	4.46
	CH ₃	-531.07	-1536.92	-8585.91	525.2	475.6	460.2	6.15	4.41	4.41

原子依次为 C、N 和 O 时, E_{ZP} 值逐渐减小.

2.3.2 焓变 ΔH

考虑如下化学反应的焓变, 就可得到 X-N 化学键的平均键能:



我们对(1)、(2)式 22 种反应物进行了 B3LYP/6-311G* 方法的结构优化, 所得能量进行零点能校正后, 求得相应焓变 ΔH . 表 4 给出了(1)、(2)两式的焓变值, 由表 4 可见, 所有 ΔH 均为负值, 表明化学反应为放热反应. $(RSiN)_4$ 和 $(CNR)_4$ 对应的焓变值较大, $(RCN)_4$ 次之, $(SiNR)_4$ 和 $(GeNR)_4$ 最小, X 相同的每一类簇合物的焓变值相近, 如 $(RSiN)_4$, 当 R 为 H、CH₃、NH₂ 和 OH 时, 分别为 -325.8、-321.2、-320.5 和 -325.6. 表明 Si-N 化学键的强度受 R 的影响较小.

表 4 化学反应的焓变 ΔH

Table 4 The enthalpy variation ΔH of the chemical reaction

Process	X	$\Delta H / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
		H	CH ₃	NH ₂	OH
(1)	C	-287.0	-243.6	-231.2	-234.1
	Si	-325.8	-321.2	-320.5	-325.6
	Ge	-272.2	-268.6	-256.6	-271.4
(2)	C	-357.0	-321.0		
	Si	-82.4	-75.8	-77.7	-90.7
	Ge	-108.9	-98.1	-94.6	-103.0

References

- 1 Eaton P E, Cole T W. *J. Am. Chem. Soc.*, **1964**, **86**: 3157
- 2 Matsumoto H, Higuchi K, Kyushin M, Goto M. *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.*, **1992**, **31**: 1354
- 3 Lukin K A. *J. Am. Chem. Soc.*, **1997**, **119**: 9591
- 4 Del Piero G, Cesari M, Dozzi G, Mazzei A. *J. Organomet. Chem.*, **1977**, **129**: 281
- 5 Veith M. *Chem. Rev.*, **1990**, **90**: 3
- 6 Veith M, Frank W. *Chem. Rev.*, **1988**, **88**: 81
- 7 Veith M, Grosser M Z. *Naturforsch.*, **1982**, **B37**: 1375
- 8 Veith M, Sommer M L, Jäger D. *Chem. Ber.*, **1979**, **112**: 2581
- 9 Veith M, Schlemmer G. *Chem. Ber.*, **1982**, **115**: 2141
- 10 Cheu Hong, Ruth A B, Rasika H V D, Marilyn M O, Power P P. *Inorg. Chem.*, **1991**, **30**: 3390
- 11 Allan R E, Beswick M A, Edwards A, Power M A, Rennie M A, Raithby P R, Wright D S. *J. Chem. Soc. Dalton Trans.*, **1995**: 1991
- 12 Grigsby W J, Hascall T, Ellison J J, Olmstead M M, Power P P. *Inorg. Chem.*, **1996**, **35**: 3254
- 13 Alexey Y T, Holger F B, Henry F S. *J. Am. Chem. Soc.*, **1997**, **119**: 5668
- 14 Wu HS, Zhang CJ, Xu XH, Zheng LS, Zhang QE. *Science in China B*, **2000**, **43**(6): 634
- 15 Wu HS, Xu XH, Zhang CJ, Zhang QE. *Chinese Science Bulletin*, **2001**, **46**(9): 713 [武海顺, 许小红, 张聪杰, 张富强, 张乾二. 科学通报 (Kexue Tongbao), **2001**, **46**(9): 713]
- 16 Wu H S, Xu X H, Zhang F Q, Jin Z H. *J. Molecular Structure (Theochem)*, **2001**, **542**: 239

Structure and Chemical Bonding of $(XN)_4R_4$ Cubic Clusters*

Wu Hai-Shun Xu Xiao-Hong Zhang Cong-Jie Zhang Fu-Qiang

(Department of Chemistry, Shanxi Normal University, Linfen 041004)

Abstract Using density function theory (DFT), the geometries, electron structure, vibration frequency and enthalpy variation of the chemical reaction of $(XN)_4R_4$ ($X = C, Si, Ge$; $R = H, CH_3, NH_2, OH$) and its precursor compound $(RXNR)_2$ have been calculated at B3LYP/6-311G* level. The results show that $(RCN)_4$ is more stable than $(CNR)_4$. E_{ZP} is the smallest when $R = H$ and the largest as $R = CH_3$, and decreases generally as R is C, N and O.

Keywords: $(XN)_4R_4$ cubic clusters, Density function theory (DFT) method, Structure, Chemical bond

Received: August 14, 2001; Revised: October 22, 2001. Correspondent: Wu Hai-Shun (E-mail: wuhhs@dns.sxtu.edu.cn).

* The Project

Supported by NSF of Shanxi Province and the Foundation for University Key Teacher by the Ministry of Education